

## МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ПЛЕНОК ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ С ICP ИСТОЧНИКОМ

### МВУ ТМ ИЗОФАЗ 02

**Назначение:** Осаждение диэлектрических материалов из газовой фазы с плазменной активацией в ВЧ разряде.



#### Особенности:

- Индивидуальная обработка подложек в одном технологическом цикле: до  $\varnothing$  150 мм – 1 шт.;
- Реактор с источником ICP плазмы;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ в диапазоне 30 – 200 Вт;
- Равномерная подача химических реактивов на поверхность подложки через газовый душ;
- Нагрев подложек до 400°C;
- Рабочие газы: SiH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>, Ar;
- Безмасляная система откачки;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 4 кВт.

